

(参考) 特許料等の減免措置一覧表 (2014年4月現在)

減免対象者	根拠法令	措置内容
中小ベンチャー企業・小規模企業等 (※平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合に限る。)	産業競争力強化法第75条	<特許> 審査請求料：1/3に軽減 特許料(第1～10年分)：1/3に軽減 調査手数料・送付手数料：1/3に軽減 予備審査手数料：1/3に軽減
個人(所得税非課税者等)	特許法第109条、第195条の2 実用新案法第32条の2、第54条	<特許> 審査請求料：免除又は半額軽減 特許料(第1～3年分)：免除又は半額軽減 特許料(第4～10年分)：半額軽減 <実用新案> 実用新案技術評価請求料：免除又は半額軽減 登録料(第1～3年分)：免除又は3年間猶予
法人(非課税法人等)	特許法第109条、第195条の2	<特許> 審査請求料：半額軽減 特許料(第1～10年分)：半額軽減
研究開発型中小企業	産業技術力強化法第18条 中小ものづくり高度化法*2第9条 アジア拠点化推進法*3第10条	
アカデミック・ディスカウント (大学等*1、大学等の研究者)	産業技術力強化法第17条	
独立行政法人*1		
公設試験研究機関		
地方独立行政法人		
承認TLO*1	TLO法*4第8条	
認定TLO*1	TLO法*4第13条	

*1 料金が免除となる場合があります。詳細は下記の表を御覧ください。

- *2 中小ものづくり高度化法：中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律
- *3 アジア拠点化推進法：特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法
- *4 TLO法：大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

※料金の免除対象一覧

対象	出願日		
	～H16.3.31	H16.4.1～H19.3.31	H19.4.1～
国	免除(特許・実用新案・意匠・商標)		
国の試験研究機関から権利を譲り受けた認定TLO	免除(特許・実用新案) <TLO法第12条>		
国立大学法人 大学共同利用機関法人 (独)国立高等専門学校機構	免除(特許) <産業技術力強化法附則第3条>	※上記「アカデミック・ディスカウント」による減免措置の対象	
国立大学法人、大学共同利用機関法人、(独)国立高等専門学校機構から権利を譲り受けた承認TLO	免除(特許) <TLO法附則第3条>	※上記「承認TLO」を対象とした減免措置の対象	
H16.3.31時点で特許法施行令に指定されていた独立行政法人	免除(特許・実用新案・意匠・商標) <改正法*5附則第2～5条>	※上記「独立行政法人」を対象とした減免措置の対象	
国立大学、独立行政法人から権利を譲り受けた認定TLO	免除(特許・実用新案) <改正法附則第8条>	※上記「承認TLO」又は「認定TLO」を対象とした減免措置の対象	

*5 特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)

問い合わせ先：総務課